Интегральная поглощательная способность диэлектрических покрытий на металлической основе в ИК-диапазоне длин волн

В.С. Виноградов, А.В. Иванов, А.А. Пальчиц, В.В. Чередов

В данной работе проведено исследование влияния толщины ряда диэлектрических покрытий, нанесенных на металлическую основу, на интегральную поглощательную способность (коэффициент теплового излучения) системы "подложка-покрытие", как целого в диапазоне длин электромагнитных волн 1÷25 мкм.

1. Методика подготовки образцов и техника ИК-измерений

Для проведения измерений были выбраны следующие пары покрытий и подложек: двуокись титана (TiO_2) на титановой основе, окись меди (CuO) и стеариновая сажа на медной поверхности.

Окисные покрытия изготавливались путем контролируемого окисления соответствующей металлической подложки на воздухе.

В качестве материалов подложки, на которой затем формировалась окисная пленка, были использованы техническая медь M2 и титан марки BT4. Образцы подложки представляли собой пластины размером 40×40 мм, полированные с обеих сторон до пятого класса чистоты. Толщина медной пластины составляла 1 мм, титановой -3 мм.

Окисление подложек проводилось в трубчатой печи на воздухе, при температурах: медной — 300°С, титановой — 500°С. Для испытаний был подготовлен ряд идентичных образцов. Первый образец являлся контрольным и окислению не подвергался. Остальные образцы окислялись в идентичных условиях, но различное время. При этом образец помещался в разогретую до требуемой температуры печь. Время нагрева образца входило в общее время экспозиции образца в печи. По окончании времени экспозиции медный образец вынимался из печи и охлаждался на воздухе при комнатной температуре, титановый — охлаждался вместе с печью. Время охлаждения в общее время экспозиции не входило. До и после процедуры окисления каждый образец взвешивался на лабораторных аналитических весах с точностью ±0,5 мг. По разности веса образца до и после процедуры окисле-

ния определялся привес образца Δm (в мг). По величине привеса Δm определялся удельный привес $\Delta m/S$ (мг/см²), исходя из которого рассчитывалась толщина h окисной пленки, образовавшейся на окисленном образце-подложке

$$h = \alpha \frac{\Delta m}{S\rho} \tag{1}$$

где ρ – плотность окисной пленки, S – площадь образца, α – числовой коэффициент, определяемый соотношением молярных масс компонент окисла. Для медных образцов α принималось равным 2,5, для титановых – 1,25.

При расчете толщины окисной пленки предполагалось, что пленки имеют стехиометрический состав CuO и TiO_2 , соответственно. В связи с тем, что реальный состав окислов на поверхности образца может отличаться от стехиометрического, полученные значения толщины окисной пленки могут иметь заметную систематическую ошибку.

Параметры образцов до и после окисления, а также результаты сопутствующих расчетов представлены в таблице 1.

Материал образцов Медь Титан NN образцов 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 0 2 5 15 30 60 0 10 20 90 240 Время окисления, мин 0,25 0,75 1,57 2,00 2,90 Удельный привес, мг/см² 0 0.05 0.11 0.45 0.94 Расчетная толшина, мкм 5,6 11,7 15,0 21,8 0 0.3 0.7

Таблица 1.

Нанесение углерода на поверхность меди осуществлялось методом осаждения углеродной фракции пламени стеариновой горелки на холодную поверхность подложки. Толщина покрытия варьировалась временем экспозиции и оценивалась по изменению веса образцаподложки.

$$h = \frac{\Delta m}{S\rho} \tag{2}$$

где ρ – плотность углеродного покрытия, S – площадь покрытия, Δm – привес образца подложки. При оценках величины h плотность углеродного покрытия принималась равной 2 г/см².

Поглощательная способность (коэффициент теплового излучения) изготовленных образцов определялся интегрально в спектральном диапазоне длин волн 1÷25 мкм с использованием инфракрасного (ИК) измерителя температур "Кельвин-400ЛЦ". Схема измерительной установки приведена на рис. 1.

Схема установки

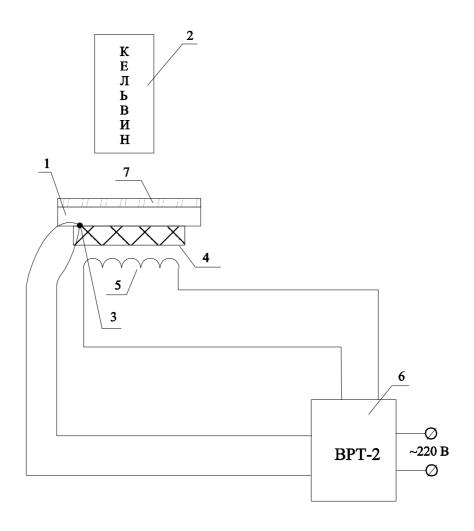


Рисунок 1.

Электромагнитное излучение с исследуемой поверхности (1, 7), прошедшее через фокусирующую систему и модулятор измерителя температур (2), регистрировалось ИК-датчиком прибора. Электронный тракт обработки прибора позволял получать информацию в цифровом виде либо о температуре поверхности при заданном коэффициенте поглощения (степени черноты), либо о коэффициенте поглощения (степени черноты) при заданной температуре поверхности. При обработке сигнала с датчика в измерителе температур (2) использовалась модель серого тела.

Необходимая температура (70÷200°С) образца обеспечивалась путем его радиационного нагрева с помощью устройства, которое представляло собой массивную металлическую поверхность (4), нагреваемую с помощью электрической спирали (5), подключаемую к силовому выходу регулятора температур ВРТ-2. Контроль температуры поверхности исследуемого образца осуществлялся с использованием хромель-алюмелиевой термопары (3), показания которой подавались на измерительный вход прибора ВРТ-2 (6).

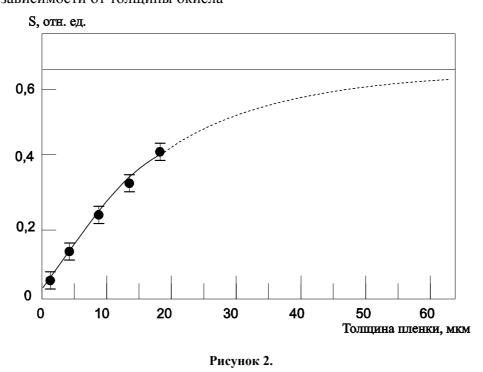
Поглощательная способность (интегральная степень черноты) исследуемой поверхности

определялась следующим образом. В процессе измерения на шкале температур прибора "Кельвин" принудительно устанавливалась температура, показываемая термопарой, затем по шкале степени черноты делался соответствующий отсчет. Результирующее значение интегральной степени черноты определялось усреднением 7-10 независимых единичных измерений, что позволяло избежать грубых ошибок однократного измерения. Проведенный цикл тестовых измерений показал, что абсолютная ошибка измерения величины S заметно превышает аппаратную погрешность ($\pm 0,01$) и в ряде случаев может достигать $\pm 0,05$.

2. Результаты измерений и обсуждение

Результаты измерений поглощательной способности образцов представлены на рисунках 2, 3, 4. Для образцов CuO-Cu измерения проводились при температуре 94°C. Из рисунка 2 видно, что с ростом толщины покрытия происходит увеличение коэффициента серости системы CuO-Cu. Очевидно, что это увеличение может происходить лишь до определенной величины, равной коэффициенту серости собственно окиси меди. В данном эксперименте это максимальное значение S достигнуто не было. На рисунке 2 максимально возможное значение коэффициента серости бинарной системы, равное 0,65, отмечено в виде горизонтальной сплошной линии.

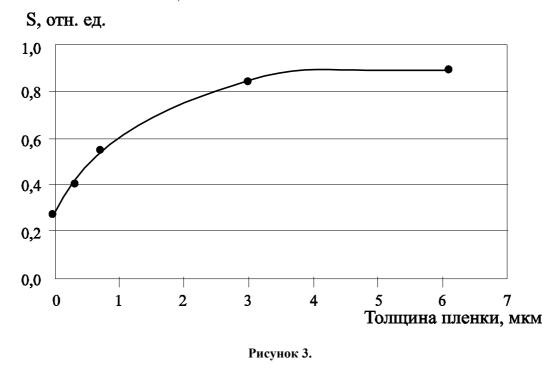
Излучательная способность бинарной системы CuO-Cu в зависимости от толшины окисла



Измерения поглощательной способности образцов TiO₂-Ti проводились при температуре

Излучательная способность бинарной системы

TiO₂-Ti в зависимости от толщины окисла



Поглощательная способность (коэффициент серости) системы увеличивается от значения S=0,27, характерного для полированного титана, до, примерно, 0,9. Последняя величина показывает, что оптические свойства системы в диапазоне длин волн ИК-излучения 1-25 мкм практически полностью определяются свойствами покрытия (TiO_2) при толщинах более 3 мкм.

Результаты измерения коэффициентов серости образцов системы C-Cu в зависимости от толщины покрытия представлены на рисунке 4.

Излучательная способность бинарной системы C-Cu в зависимости от толщины окисла

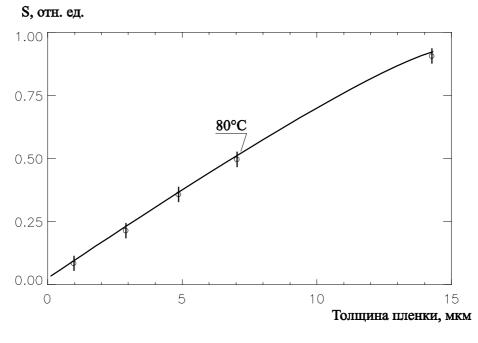


Рисунок 4.

Измерения проводились при температуре 80°C. Характер полученной зависимости такой же как и на рисунках 2 и 3. Насыщение коэффициента серости с ростом толщины покрытия достигнуто не было. Однако предельная величина S для стеариновой сажи известна [1] и составляет 0,92-0,96.

Сопоставление результатов для всех исследованных систем (рис. 2, 3, 4) показывает, что наиболее высокий линейный коэффициент поглощения ИК-излучения проявляет TiO_2 -покрытие. Для покрытий из сажи и CuO "насыщение" поглощательной способности происходит при значительно больших толщинах покрытия, чем у TiO_2 : $TiO_2 - 3$ мкм, CuO - 50 мкм, сажа — более 15 мкм. Это, по-видимому, свидетельствует о более высокой проводимости титанового окисла.

В целом проведенные измерения показывают, что диэлектрические покрытия с интегральной степенью черноты, близкой к единице, могут заметно повлиять на интенсивность теплового излучения металлической поверхности.

Используем основные положения оптики для анализа полученных результатов.

Интенсивность излучения подложки $I_{_{M}}$ прошедшего через слой покрытия толщиной d , можно вычислить в соответствии с законом Бюргерса-Ламберта [2]

$$I_{M}(d) = I_{S} \exp(-\mu_{s\phi\phi}d) \tag{3}$$

где $\mu_{\to\phi\phi}$ — эффективный линейный коэффициент ослабления излучения в ИК-диапазоне длин волн, I_S — интенсивность излучения материала подложки при соответствующей температуре в ИК-диапазоне длин волн.

Интенсивность излучения, сформированного всей системой (подложка-покрытие), можно

представить как сумму двух потоков – $I_{\scriptscriptstyle M}$, пришедшего от подложки, через покрытие, и собственного излучения покрытия $I_{\scriptscriptstyle R}$

$$I(d) = I_{M}(d) + I_{N}(d)$$

$$\tag{4}$$

Предполагая модель серого тела как для материала покрытия, так и для материала подложки, указанные потоки можно оценить в соответствии с выражениями

$$I_n = s_n (1 - \exp(-\mu_{\phi \phi} d)) I_0$$
 (5)

$$I_{M} = S_{M} \exp(-\mu_{S\phi\phi} d) I_{0} + \Theta(d, S_{M} - S_{n}) I_{0}$$
(6)

где $s_{_M}$ и $s_{_N}$ — коэффициенты серости материала подложки и покрытия в ИК-диапазоне длин волн, соответственно, $I_{_0}$ — интенсивность излучения абсолютно черного тела при соответствующей температуре в ИК-диапазоне длин волн, $\Theta(d,s_{_M}-s_{_N})$ — корректирующая функция, учитывающая различие в оптических характеристиках материалов подложки и покрытия. Очевидно, что, если коэффициенты серости материалов покрытия и подложки одинаковы $s=s_{_M}=s_{_N}$, то корректирующая функция равняется нулю. Действительно, в этом случае суммарный тепловой поток от системы

$$I = s(1 - \exp(-\mu_{\theta \phi} d)) + s \exp(-\mu_{\theta \phi} d) = sI_0$$
(7)

что соответствует модели серого тела.

Граничные условия для корректирующей функции очевидны

$$\Theta(0, s_{M} - s_{N}) = \Theta(\infty, s_{M} - s_{N}) = 0$$
(8)

Используя соотношения (4)-(6), можно получить, что

$$I(d) = (s_n - (s_M - s_n) \exp(-\mu_{sabab}d) + \Theta(d, s_M - s_n))I_0$$
(9)

где выражение во внешних круглых скобках можно рассматривать как эффективное значение коэффициента серости бинарной системы подложка-покрытие

$$S_{\vartheta\phi\phi} = S_n - (S_M - S_n) \exp(-\mu_{\vartheta\phi\phi} d) + \Theta(d, S_M - S_n)$$
(10)

При больших $d >> 1/\mu_{\phi\phi}$ получаем $s_{\phi\phi} = s_n$, то есть наблюдаем полное экранирование излучения подложки. Излучательная способность системы в этом случае определяется только оптическими свойствами покрытия.

При малых $d << 1/\mu_{\phi\phi}$ экспонента оказывается близкой к единице, а $s_{\phi\phi}$ приближается к значению s_{M} , то есть излучение подложки "не замечает" покрытия, при этом излучательные характеристики системы определяются оптическими свойствами подложки. Формула (10) позволяет по экспериментальному значению $s_{\phi\phi}$ и известному из других источников значению $\mu_{\phi\phi}$ рассчитать корректирующую функцию Θ , либо наоборот при известной функции Θ оценить значения $\mu_{\phi\phi}$ для соответствующего материала покрытия.

Расчет корректирующей функции Θ является достаточно сложной задачей и в данной работе не проводился. Значения $\mu_{\circ \phi \phi}$ для исследуемых диапазонов длин волн и материалов покрытий в опубликованных источниках обнаружить не удалось. В этой связи по формуле (10) проведен расчет $\mu_{\circ \phi \phi}$ в предположении, что функция $\Theta = 0$. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Материал покры-	Материал	Эффективный	Диапазон
тия	подложки	коэффициент ли-	длин волн,
		нейного погло-	МКМ
		щения, мкм-1	
CuO	Cu	0,024	1-25
TiO_2	Ti	0,4	1-25
Сажа (С)	Cu	0,06	1-25

Расчетные зависимости $s_{s\phi\phi}(d)$ представлены на рисунках 2, 3, 4, откуда видно хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных. Последнее свидетельствует о том, что модель, используемая для определения зависимости поглощательной способности системы типа "подложка-покрытие" от толщины слоя, вполне пригодна для описания оптических свойств системы с тонким диэлектрическим покрытием.

Список литературы

- [1] Кикоин А.А. Таблицы физических величин. Справочник М.: Энергоатомиздат, 1993. 827 с.
- [2] А.М. Кольчужкин, В.В. Учайкин. Введение в теорию прохождения частиц через вещество. М.: Атомиздат, 1978. 342 с.